

原子层沉积系统

Atomic Layer Deposition System TALD.PEALD



沈阳科仪设备



微电子所设备

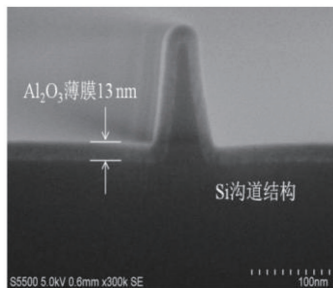
性能指标

- 非均匀性：氧化铝 $\leq \pm 1\%$
- 沉积材料：氧化物、氮化物、单质等
- 气路：最大 6 路液态前驱体源

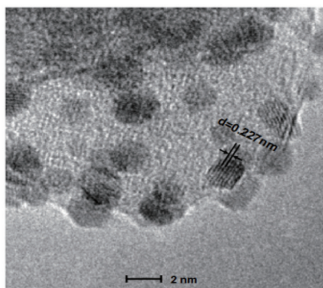
主要应用

微电子器件、光伏、催化等领域的薄膜沉积

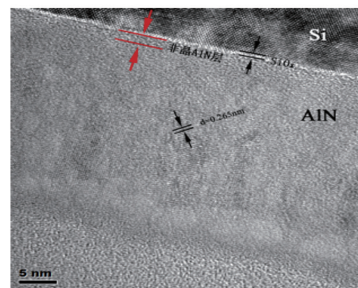
代表性应用成果



氧化铝薄膜沉积



铂单质颗粒沉积



氮化铝薄膜沉积

| | |
|--------|---|
| 主要用户单位 | 清华大学、北京大学、中国科学院半导体研究所、国家纳米科学中心 |
| 研制单位 | 中国科学院微电子研究所 / 嘉兴科民电子设备技术有限公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 |
| 联系方式 | 何老师 010-62049399, 13581817539 hemeng@ime.ac.cn 024-23826855 |